

О ПРИРОДЕ ФОТОИНДУЦИРОВАННОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ДЕФЕКТОВ В АМОРФНОМ ГИДРИРОВАННОМ КРЕМНИИ

А.Г.Петухов, А.В.Радчик, М.Г.Фойгель

Показано, что комплекс из двух достаточно близких электрически нейтральных дефектов типа "оборванных связей" в $a\text{-Si : H}$ неустойчив по отношению к спариванию электронов на одном из дефектов. Фотовозбуждение переводит комплекс в метастабильное состояние с неспаренными спинами, локализованными на разных дефектах.

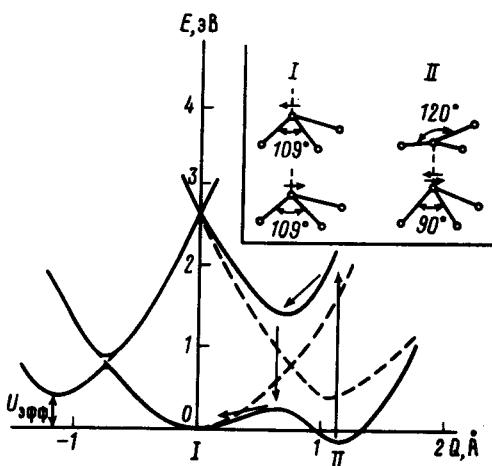
При длительном возбуждении электронной подсистемы, например, при поглощении света с энергией квантов $\hbar\omega \gtrsim 1,6$ эВ, в $a\text{-Si : H}$ наблюдается переход из основного состоя-

ния A в метастабильное долгоживущее состояние B , которое характеризуется повышенной в два – четыре раза по отношению к исходной концентрацией локализованных спинов $1 - 3$. Существенно, что g -фактор фотоиндуцированного сигнала ЭПР совпадает с g -фактором сигнала ЭПР в состоянии A , который, в свою очередь, обусловлен локализованным спином электрона на изолированной нейтральной оборванной связи T_3^0 . В данной работе предлагается микроскопическая модель, которая позволяет непротиворечиво объяснить описанное выше явление.

Рассмотрим комплекс из двух изолированных оборванных связей T_3 с двумя электронами. Гамильтониан такой системы в адиабатическом приближении запишем в виде

$$H_0 = 2\epsilon_h - \lambda \sum_i u_i (\sum_{\sigma} n_{i\sigma} - 1) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} + \frac{1}{2} k \sum_i u_i^2, \quad (1)$$

где ϵ_h – энергия электрона в состоянии T_3^0 , $n_{i\sigma} = a_{i\sigma}^+ a_{i\sigma}$ – число заполнения состояния i -ой оборванной связи со спином σ ($i = 1, 2$, $\sum_{i\sigma} n_{i\sigma} = 2$), U – хаббардовская энергия отталкивания двух электронов на одном центре, u_i – смещение i -го атома из положения равновесия вдоль направления оборванной связи, k – силовая постоянная. Мы предполагаем, что в равновесии атом, на котором локализована оборванная связь, находится в центре тетраэдра и может смещаться только вдоль его оси так, что атомы, лежащие в основании, жестко закреплены. В (1) линейный по смещениям член возникает из-за изменения характера гибридизации состояния оборванной связи 4 . (Так, по мере смещения атома к плоскости основания ($u_i < 0$) исходная sp^3 -гибридизованная орбиталь переходит в состояние p_z , а при смещении в противоположном направлении – в состояние s . Спаривание двух электронов на изолированном центре энергетически выгодно, если $U_{\text{эфф}} = U - \frac{\lambda}{k} < 0$ 5 . Однако экспериментальная ситуация в $a\text{-Si : H}$, по-видимому, такова, что $U_{\text{эфф}} \approx 0,4 \text{ эВ} > 0$ $^2, 6$ (см. рисунок).



Адиабатические потенциалы двух изолированных дефектов T_3 (штриховые линии) и комплекса двух близких оборванных связей (сплошные линии). Номера минимумов соответствуют номерам конфигураций на вставке

При сближении оборванных связей между ними возникает дополнительное взаимодействие

$$H_{int} = V \sum_{i \neq j, \sigma} a_{i\sigma}^+ a_{j\sigma} + C \sum_{i \neq j, \sigma, \sigma'} n_{i\sigma} n_{j\sigma}, \quad (2)$$

обусловленное, соответственно, туннелированием электрона между состояниями T_3^0 и кулоновским взаимодействием между электронами, локализованными на разных центрах. В случае, когда оборванные связи направлены вдоль одной прямой в одну сторону (см. вставку на рисунке), функции V и C зависят только от разности смещений $Q = u_1 - u_2$, причем линейный по смещениям член в (1) имеет вид $\lambda Q \sum_{\sigma} (n_{2\sigma} - n_{1\sigma})$, т. е. задача с $H = H_0 + H_{int}$ становится существенно одномерной.

Полный гамильтониан $H = H_0 + H_{int}$ удается диагонализовать методом, описанным в ⁷. В результате триплетный уровень $E_t = \frac{1}{4}kQ^2 + C(Q)$, а энергии синглетных состояний $E_s = E_t + E_1$, где E_1 удовлетворяет уравнению:

$$E_1^3 + 2\bar{U}E_1^2 - E_1[\bar{U}^2 - \lambda^2 Q^2 - 4V^2(Q)] - 4V^2(Q)\bar{U} = 0, \quad (3)$$

где $\bar{U} = U - C(Q)$. Для оценок положим $C \approx e^2/\kappa(R_0 - Q)$, где κ – диэлектрическая постоянная, e – заряд электрона, а $R_0 \gg Q$ есть "затравочное" расстояние между дефектами. Зависимость величины интеграла туннелирования V от расстояния $R = R_0 - Q$ между дефектами аппроксимируем функцией

$$V(R) = \begin{cases} V_0, & R < R_1 \\ \beta(R_2 - R), & R_1 < R < R_2 \\ 0, & R > R_2 \end{cases} \quad (4)$$

Отметим, что характерный размер $R_2 - R_1$ области наиболее резкого изменения величины V порядка радиуса локализации a электрона в состоянии T_3^0 , а величина $R_1 \gtrsim d$, где d – расстояние между ближайшими соседями ($d \approx a$). Из (3) следует, что при сближении дефектов в области $R_1 < R < R_2$ за счет выигрыша в кулоновской энергии и достаточно резкого изменения величины $V(Q)$ может стать выгодной сильно искаженная конфигурация II со спаренными электронами на одном из дефектов (см. рисунок). Нетрудно видеть, что рассмотренная здесь ориентация дефектов обеспечивает максимальный эффект.

Для $R_0 \approx R_1$ в предположении слабой зависимости $C(Q)$ критерий подобного спаривания имеет вид

$$\begin{aligned} U - C_0 - \frac{\lambda^2}{\mu k} &< 0, & \mu &= \frac{1}{2}(1 - \alpha + \sqrt{1 - 2\alpha}) \\ \alpha = \frac{8\beta^2}{k(U - C_0)} &< \frac{1}{2}, & C_0 &\approx \frac{e^2}{\kappa R_0}. \end{aligned} \quad (5)$$

При $\alpha \geq \frac{1}{2}$ состояние I с неспаренными спинами становится абсолютно неустойчивым аналогично тому, как это происходит при псевдоэффекте Яна – Теллера. Численные оценки с параметрами $U_{\text{эфф}} = 0,4 \text{ эВ}^2$, $\lambda = 6,4 \cdot 10^{-9} \text{ Н}$, $k = 112 \text{ Н/м}$, а также $\beta \approx V_0/a = 1,2 \cdot 10^{-9} \text{ Н}^4$, $C_0 = 0,25 \text{ эВ}$ показывают, что условие (5) в $a\text{-Si : H}$ может выполняться для пар дефектов с $R_0 \lesssim 2 \div 3d$.

Возбуждение переводит систему из основного состояния II(A) в метастабильное состояние I(B) со слабо спаренными спинами, локализованными на разных дефектах (см. рисунок). Следует, однако, отметить, что для приведенных выше значений параметров величина барьера для термостимулированного обратного перехода I \rightarrow II порядка десятых долей эВ, что меньше наблюдаемой на эксперименте энергии активации обратного времени τ^{-1} хранения состояния B. По нашему мнению, аномально большие времена τ обусловлены перераспределением водорода между связями Si – H и образованными в результате возбуждения метастабильными состояниями I. Возникающие таким образом изолированные состояния T_3^0 по современным представлениям ^{2, 6}, способны обеспечить фотоиндуцированное изменение оптических и электрических констант $a\text{-Si : H}$.

Отметим, также, что в $a\text{-Si : H}$ было обнаружено сильное решеточное ИК поглощение в области частот $\lesssim 500 \text{ см}^{-1}$, которое формально описывается введением эффективного ионного заряда Si – Si связей $e_T^* = 0,5 e$ ⁸. Столь большую ионность естественно связать с устойчивыми конфигурациями II(A) дипольного типа. Поэтому представляется интересным проследить за уменьшением ИК активности $a\text{-Si : H}$ в указанной области частот при переходе системы из состояния A в метастабильное состояние B.

Наличие в $a\text{-Si : H}$ двухъязычных потенциалов, связанных с комплексами достаточно близких оборванных связей (рисунок) позволяет в духе теории ⁹ объяснить и наблюдав-

шуюся экспериментально 10 , близкую к линейной зависимость теплоемкости $c(T)$ при низких температурах.

Авторы признательны К.А.Кикоину, Э.М.Омельяновскому и В.Н.Флерову за обсуждение результатов работы.

Литература

1. Staebler D.L., Wronski C.R. J. Appl. Phys., 1980, 51, 3262.
2. Adler D. Solar Cells, 1983, 9, 133.
3. Taylor P.C., Ohlsen W.D. Solar Cells, 1983, 9, 113.
4. Харрисон У. Электронная структура и свойства твердых тел. М.: Мир, 1983, т. 1, 381.
5. Anderson P.W. Phys. Rev. Lett., 1975, 34, 953.
6. Morigaki K., Nitta S. Techn. Rept. ISSP, 1984, № 1456.
7. Huang C., Moriarti J.A., Sher A., Breckenridge R.A. Phys. Rev., 1975, B12, 5335.
8. Shen S.C., Cardona M. Phys. Rev., 1981, B23, 5322.
9. Anderson P. W., Halperin B.I., Varma C.M. Phil. Mag., 1973, 25, 1.
10. Graebner J.E., Golding B., Allen L.C., Knights J.C., Biegelsen D.K. Phys. Rev., 1984, B28, 3744.

Научно-исследовательский институт физики
Одесского государственного университета
им. И.И.Мечникова

Поступила в редакцию
14 апреля 1985 г.